

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 3月27日

出 願 番 号 Application Number:

人

特願2003-088306

[ST. 10/C]:

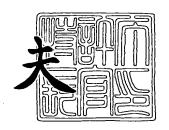
[JP2003-088306]

出 願
Applicant(s):

三菱電機株式会社

2003年10月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

544763JP01

【提出日】

平成15年 3月27日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01S 3/18

【発明者】

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会

社内

【氏名】

石村 栄太郎

【特許出願人】

【識別番号】

000006013

【住所又は居所】

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

【氏名又は名称】

三菱電機株式会社

【代理人】

【識別番号】

100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】

青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】

100086405

【弁理士】

【氏名又は名称】 河宮 治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

013262

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 光半導体素子用パッケージ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 上面と下面を有しその上面に光半導体素子を実装するマウントが設けられかつ上記上面から上記下面に貫通する貫通孔が設けられたステムと、該貫通孔を絶縁体を介して絶縁されて貫通する信号供給用リード端子とを備えた光半導体素子用パッケージにおいて、

上記貫通孔と上記絶縁体と上記信号供給用リード端子とによって構成される伝送線路の特性インピーダンスと、上記上面から突出した信号供給用リード端子によって構成される伝送線路の特性インピーダンスとの差が小さくなるように、上記上面から突出した信号供給用リード端子に近接して接地導体を設けたことを特徴とする光半導体素子用パッケージ。

【請求項2】 上記接地導体は、上記上面から突出した信号供給用リード端子の少なくとも一部を取り囲むように設けた請求項1記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項3】 上記接地導体は、上記信号供給用リード端子の中心軸を中心 として150°以上の範囲に亙って上記信号供給用リード端子を取り囲むように 設けた請求項2記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項4】 上記接地導体は、上記信号供給用リード端子の中心軸を中心 として210°以上の範囲に亙って上記信号供給用リード端子を取り囲むように 設けた請求項2記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項5】 上記接地導体は、上記マウントと一体で構成されている請求項1~4のうちのいずれか1つに記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項6】 上記接地導体は、上記絶縁体の一部と重なるように設けられている請求項1~5のうちのいずれか1つに記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項7】 上記接地導体と上記信号供給用リード端子の間に誘電体を設けた請求項1~6のうちのいずれか1つに記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項8】 上記ステムの下面から突出した上記信号供給用リード端子の両側にグランド電極用端子を設けた請求項1~7のうちのいずれか1つに記載の



光半導体素子用パッケージ。

【請求項9】 上記グランド電極用端子は、上記ステムと一体で構成された 請求項8記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項10】 上記信号供給用リード端子を2つ対にして設けた請求項1 ~9のうちのいずれか1つに記載の光半導体素子用パッケージ。

【請求項11】 上記グランド電極用端子を3つ有しており、上記2つの信号供給用リード端子はそれぞれ2つのグランド電極用端子により挟まれている請求項10記載の光半導体素子用パッケージ。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、光半導体素子用パッケージ、特に高周波特性に優れた光半導体素子 用パッケージに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、光通信において、伝送速度は、600Mbpsから2.5Gbps、さらには10Gbpsと次々に高速化されており、それに伴ない光送受信器に用いら入れる発光・受光素子にはより高速化が求められている。また、同時に、発光・受光素子を搭載するパッケージにもより高周波特性がよく、安価なものが要求される。このような発光受光素子を搭載するパッケージには、箱形状でストリップライン等を用いたバタフライ型と、同軸形状で構造のシンプルなステム型がある。

[0003]

従来のステム型パッケージは、図9(a),(b)に示すように、ステムボティー113を用いて以下のように構成される。ステムボティー113の貫通孔には、ステムボティー113を貫通するように、一対のフォトダイオード用リード端子105と信号供給用リード端子112がガラス材料106により絶縁されて設けられる。また、ステムボティー113の上面には、サブマウント102及び半導体レーザ103が搭載されるマウント901が信号供給用リード端子112



に隣接して設けられ、サブマウント108とモニター用フォトダイオード107とを取り付ける凹部109が形成される。ここで、凹部109は、サブマウント108を介して設けられたモニター用フォトダイオード107に、半導体レーザダイオードの出射面の反対側のモニター側端面から出射されたレーザ光が入力されるような位置に形成される。尚、図9(a)において、114の符号を付して示すものは、接地用リード端子である。

[0004]

以上のように構成されたステムを用いて、マウント901の1つの側面にサブマウント102を介して半導体レーザ103を搭載し、凹部109にサブマウント108を介してモニター用フォトダイオード107を搭載して、所定のリード端子との間をワイヤ104,110,111により接続することにより半導体レーザ装置が構成される(例えば、特許文献1)。

[0005]

以上のように構成された半導体レーザ装置において、信号給電用リード端子112とグランド用リード端子114の間に1.5 V程度の電圧を印加すると、半導体レーザダイオードに数十mA程度の電流が流れ、レーザ光が出射される。また、出射面と反対側の端面から出射されるレーザ光はモニター用のフォトダイオード107によって受光され、半導体レーザ103の出射光量が監視される。

また、これらのステム型の光半導体素子用パッケージでは、半導体レーザ素子が発生する熱を効果的に放出する放熱特性を向上させた構造も提案されている(特許文献 2, 3, 4)。

[0006]

【特許文献1】

米国特許出願公開第2002/0041612A1

【特許文献2】

特開昭 58 - 98995号公報

【特許文献3】

米国特許第5, 262, 675号

【特許文献4】

特開平07-240565号公報

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の光半導体素子用パッケージには、バタフライ型は高周波特性はよいが、構造が複雑であるために非常に高価であり、一方、ステム型は安価であるが、高周波特性が悪く、10Gbpsの高速伝伝送に用いることは困難であるという問題がある。

[0008]

そこで、本発明は、10Gbpsの高速伝伝送用に用いることができる高周波特性の良好なステム型のパッケージを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

以上の目的を達成するために、本発明に係る光半導体素子用パッケージは、上面と下面を有しその上面に光半導体素子を実装するマウントが設けられかつ上記上面から上記下面に貫通する貫通孔が設けられたステムと、該貫通孔を絶縁体を介して絶縁されて貫通する信号供給用リード端子とを備えた光半導体素子用パッケージにおいて、上記貫通孔と上記絶縁体と上記信号供給用リード端子とによって構成される伝送線路の特性インピーダンスと、上記上面から突出した信号供給用リード端子によって構成される伝送線路の特性インピーダンスとの差が小さくなるように、上記上面から突出した信号供給用リード端子に近接して接地導体を設けたことを特徴とする。

 $[0\ 0\ 1\ 0]$

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明に係る実施の形態の光半導体デバイスについて説明する。

実施の形態 1.

図1は、本発明に係る実施の形態1の光半導体デバイスの斜視図(a)と平面図(b)である。この実施の形態1の光半導体デバイスは、光通信用レーザデバイスであって、本願特有の光半導体素子用パッケージとレーザ素子等の光半導体

素子とを用いて構成される。具体的には、本実施の形態1の光半導体デバイスにおいて、その光半導体素子用パッケージは、高周波特性を良好にするために、図9に示す従来例の光半導体素子用パッケージにおいて、マウント901に代えてマウント101を用いて構成した以外は、図9と同様に構成される。尚、図1において図9と同様のものには同様の符号を付して示している。

[0011]

実施の形態1の光半導体デバイスにおいて、光半導体素子用パッケージのマウント101は、例えば、電気伝導性と熱伝導性に優れた金属からなり、図1(a)(b)に示すように、レーザ素子103等を取り付けるマウント面101bと信号供給用リード端子112を取り囲む円周面101aとを有している。そして、マウント面101b上には、サブマウント102を介してレーザ素子103が取り付けられ、取り付けられたレーザ素子103がステムボディー113上面の上方ほぼ中央部に位置しかつ円周面101aが信号給電用リード端子112と同軸になるようにステムボディー113の上面にマウント101は配置される。ここで、光半導体素子用パッケージにおいて、マウント101の円周面101aは、信号供給用リード端子112が挿入される貫通孔とほぼ同じ径に形成されている。

ここで、マウント101は、鉄及び鉄の合金、銅及び銅合金などの金属、又は表面をメタライズした誘電体等からなり、実施の形態1の光半導体素子では、マウント101の円周面101aによって、信号供給用リード端子112を取り囲む接地導体が構成される。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

尚、本実施の形態1の光半導体素子用パッケージにおける各要素の寸法は、例 えば以下の範囲内に設定される。

ステムボティー113の直径:2~10mm、

ステムボティー113の厚さ $: 0.5 \sim 2 \, \text{mm}$ 、

信号供給用リード端子112がステムボティー113の上面から突出した高さ: 0.3 mm~2 mm、

マウント101の高さ: 0.3 mm~2 mm、

ガラス材料106の直径(貫通孔径):0.3mm~3mm、信号供給用リード端子112の直径:0.2mm~2mm、

[0013]

以上のように構成された実施の形態1の光半導体デバイスにおいて、信号供給用リード端子112に供給された信号は、伝送線路Cと伝送線路Dを伝送されて半導体レーザ素子103に供給される。ここで、伝送線路Cは、ステムボディーの貫通孔の部分で貫通孔の内壁とガラス材料106と信号供給用リード端子112とによって構成される部分であり、伝送線路Dは、ステムボティー113の上面から突出した信号供給用リード端子112と円周面101aとによって構成される部分である。

[0014]

本実施の形態1に係る光半導体デバイスの光半導体素子用パッケージでは、ステムボティー113の上面から突出した信号供給用リード端子112を円周面101aによって取り囲んで伝送線路Dを構成しているので、伝送線路Dのインピーダンスを低くできる結果、伝送線路Cと伝送線路Dとの間のインピーダンス不整合を小さくできる。これによって、例えば、10Gbps又はそれ以上の高周波信号を半導体レーザ素子に供給する場合であっても、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射を押さえることができ、高周波伝送特性を良好にできる。

また、本実施の形態1において、マウント101とステムボディー113とは 一体で形成することができ、このようにすると、製造が容易になる。

以下、伝送線路間の反射特性について従来例と対比しながら詳細に説明する。

[0015]

一般に光半導体デバイスへの給電は、図10に示すように、給電基板を用いて行われ、伝送線路A、接続部分B、伝送線路C及び伝送線路Dを介してレーザ素子等の光半導体素子に高周波信号が供給される。ここで、伝送線路Aは、給電基板117部分の伝送線路であって、基板の一方の面上に互いに平行に形成された信号ライン115とグランドライン116からなり、信号ライン115は信号供給用リード端子112に接続され、グランドライン116は接地用リード端子114に接続される。

また、接続部分Bは、伝送線路Aと伝送線路Cの間の接続部分であり、その接続部分Bにおいてもインピーダンスの不整合が生じる。

さらに、伝送線路Cは、ステムボディー113の貫通孔の部分の伝送線路であって、貫通孔の内壁とガラス材料106と信号供給用リード端子112とによって構成される。また、伝送線路Dは、ステムボティー113の上面から突出した信号供給用リード端子112によって構成される部分である。

入力された高周波信号が伝送線路間で反射されることなく、半導体レーザに給電されるためには、伝送線路A~D間で特性インピーダンスがほぼ等しいことが好ましい。しかしながら、伝送線路A~Dの各インピーダンスは、主として各伝送線路を構成する要素の物理的形状によって決定されるものであり、かつその物理的な形状は、光半導体デバイスの全体形状及び機械的強度等も含めて総合的に決定する必要があるので自由に決定できるものではない。

[0016]

具体的には、信号供給用リード端子112の直径を0.35mm ~ 0.45 mm、ステム貫通孔の直径を $0.7\sim 1$ mm、信号供給用リード端子112とグランド用リード端子114の中心間の間隔を1mm ~ 2 mmとすると、各伝送線路のインピーダンスは次のようになる。

すなわち、伝送線路BのインピーダンスZbは、信号供給用リード端子112 とグランド用リード端子114の中心間の間隔により決定され、その間隔を1m m ~ 2 mmとすると、160 Ω 程度になる。

また、伝送線路DのインピーダンスZdは、信号供給用リード端子112の直径及び他の要素との関係により決定され、図9の従来例の構造では、約 70Ω にある。

[0017]

信号ライン115のインピーダンスZaを25Ωとすると、接続部分B及び伝送線路Dでは、インピーダンスが高くなるので、各伝送線路の境界間で大きな反

射が生じる。例えば、 $10\,G\,b\,p\,s\,o$ 伝送速度で変調するためには、 $10\,G\,H\,z\,o$ の高周波信号を入力した場合の電気反射量 $S\,1\,1\,u\,$ 、 $-\,1\,0\,d\,B$ 以下が必要であるが、従来の図 $9\,o$ 構成では、 $-\,5\,d\,B$ 以上の反射が生じ、良好な特性が得られない。

[0018]

これに対して、本実施の形態1の光半導体デバイスは、伝送線路Cと伝送線路 Dとの間の反射を小さくできる。

図2(a)は、取り囲み角度 θ に対する伝送線路Dのインピーダンス(特性インピーダンス)を、3次元電磁界シミュレータによって解析した結果を示している。また、図2(b)には、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射量S11(dB)の角度 θ 依存性の解析(シミュレーション)結果を示している。ここで、図2(a)(b)には、信号供給用リード端子112の直径を0.45mmとし、取り囲み部の内径を1mmとした場合(破線)、信号供給用リード端子112の直径を0.35mmとし、取り囲み部の内径を0.7mmとした場合(破線)について、信号周波数を10GHzとして解析した結果をそれぞれ示している。図2(a)に示すように、取り囲み角度 θ が大きくなるほど、インピーダンスは下がる傾向にある。また、図2(b)に示すように、取り囲み角度 θ が大きくなるほど、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射量S11(dB)は減衰する。

[0019]

尚、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射量S11 (dB) は、-10 dB以下であることが好ましく、取り囲み角度 θ でいうと、図2 (b) から15 0 。以上であることが好ましい。また、伝送線路Cと伝送線路Dの境界以外の部分における反射もあるので、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射量S1 1 (dB) は、-12 dB以下であることが好ましく、この反射量を実現するための取り囲み角度 θ は210。以上である。

このように、伝送線路Dにおいて、信号供給用リード端子の少なくとも一部を取り囲むように接地導体を設ける場合、該接地導体は、信号供給用リード端子112の中心軸を中心として150°以上の範囲に亙って信号供給用リード端子1

12を取り囲むように設けることが好ましく、より好ましくはその取り囲み角度 θ は 210° 以上とすると、伝送線路 D の特性インピーダンスを効果的に低くすることができる。

[0020]

実施の形態2.

本発明に係る実施の形態2の光半導体デバイスは、以下のようにして高周波特性を改善した光半導体素子用パッケージを用いて構成されている。すなわち、実施の形態2の光半導体素子用パッケージは、図3に示すように、図9の従来例の光半導体素子用パッケージにおいて、導体又は表面をメタライズした誘電体等からなる対向接地電極部201を、信号給電用リード端子112に近接してさらに設けた以外は、図9と同様に構成される。

本実施の形態2では、信号給電用リード端子112と対向接地電極部201とによって伝送線路Dが構成され、これにより、図9に示す従来例よりインピーダンスの低い伝送線路Dを構成することができる。

これにより、伝送線路Cと伝送線路Dの間の反射量を小さくできる。

[0021]

以上説明したように、実施の形態1及び2の光半導体デバイスは、上述した本 発明に特有の光半導体素子用パッケージを用いて構成されているので、高周波特 性に優れた光半導体デバイスを提供できる。

すなわち、本実施の形態1及び2の光半導体デバイスにおける光半導体素子用パッケージは、ステムボディー113に形成された貫通孔とその貫通孔にガラス材料を介して(ステムボディーと絶縁されて)挿入された信号供給用リード端子とによって構成される伝送線路Cの特性インピーダンスと、ステムボディー113の上面から突出した信号供給用リード端子112によって構成される伝送線路Dの特性インピーダンスとの差が小さくなるように、上面から突出した信号供給用リード端子に近接して接地導体(円周面101aの近傍のマウント101,対向接地電極部201)を設けている。

これにより、高周波特性に優れた光半導体デバイスを提供できる。

[0022]

実施の形態3.

本発明に係る実施の形態3の光半導体デバイスは、以下のようにして高周波特性を改善した光半導体素子用パッケージを用いて構成されている。すなわち、実施の形態3の光半導体素子用パッケージは、図4に示すように、実施の形態2の光半導体素子用パッケージにおいてさらに、対向接地電極部201と信号給電用リード端子112の間に誘電体板301(例えば、比誘電率が2~12の間の誘電体、より具体的にはアルミナ等からなる)をさらに設けた以外は、実施の形態2と同様に構成される。

本実施の形態3では、信号給電用リード端子112と対向接地電極部201と 誘電体板301とによって伝送線路Dが構成され、この誘電体板の比誘電率が真 空中(空気中)より高いことにより、図3に示す実施の形態2に示す光半導体素 子用パッケージよりさらにインピーダンスの低い伝送線路Dを構成することがで きる。

これによって、伝送線路Cと伝送線路Dとの間の特性インピーダンス差をより 小さくできる。

また、実施の形態3では、実施の形態2において、対向接地電極部201と信号給電用リード端子112の間に誘電体板301を設けるようにしたが、本発明はこれに限られるものではなく、実施の形態1において、マウント101の円周面101aと信号供給用リード端子112の間に誘電体を設けるようにしてもよく、このようにすると、実施の形態1においてさらに伝送線路Cと伝送線路Dとの間の特性インピーダンス差をより小さくできる。

[0023]

実施の形態4.

本発明に係る実施の形態4の光半導体デバイスは、以下のようにして高周波特性を改善した光半導体素子用パッケージを用いて構成されている。すなわち、実施の形態4の光半導体素子用パッケージは、図5に示すように、図9の従来例の光半導体素子用パッケージにおいてさらに、グランド用リード端子414をさらに設けた以外は従来例と同様に構成される。

実施の形態4の光半導体素子用パッケージにおいて、グランド用リード端子4

14はグランド用リード端子114との間に信号供給用リード端子112を挟むように設けられる。

以上のように構成された実施の形態 4 の光半導体素子用パッケージでは、接続部分Bにおける反射を小さくできる。

[0024]

図 6 は、ステムボディー 1 1 3 と給電基板 1 1 7 との間の間隔W(μ m)に対する接続部分Bにおける電気反射量 S 1 1 (dB)を、3次元電磁界シミュレーターで解析した結果を示すグラフである。本シミュレーションにおいて、グランド用リード端子 4 1 4 と信号供給用リード端子 1 1 2 の間の中心軸間の間隔及びグランド用リード端子 1 1 4 と信号供給用リード端子 1 1 2 の間の中心軸間の間隔は、それぞれ 1 mmとした。また、従来例のグランド用リード端子 1 1 4 と信号供給用リード端子 1 1 2 の間の中心軸間の間隔も 1 mmとした。

図6から明らかなように、グランド用リード端子414とグランド用リード端子114との間に信号供給用リード端子112を挟み込んだ本実施の形態4の光半導体素子は、間隔Wが同じ場合には反射量S11を小さくできることがわかる。ステムボディー113と給電基板との間隔を小さくしていった場合に、従来例に比較してより顕著に、反射量低減効果が現われる。

[0025]

これに対して、図9の従来例の構成では、ステムボディー113と給電基板との間に500μm程度の間隔が開いた場合には、-5dB程度の反射量となる。

[0026]

以上の実施の形態4の光半導体デバイスでは、図7に示すように、グランド用 リード端子414とグランド用リード端子114とに代えてそれぞれ、ステムボ ディー113と一体的に形成された金属突起を形成するようにしてもよい。

[0027]

実施の形態 5.

本発明に係る実施の形態5の光半導体デバイスは、図8に示すように、信号給電用リード端子112を2本備えた差動給電方式の光半導体デバイスであって、ステムボティー113の上面から突出した各信号給電用リード端子112においてそれぞれ、周りが金属円周面によって取り囲まれて、実施の形態1と同様の伝送線路Dが構成されている。

また、本実施の形態5の光半導体デバイスでは、ステムボティー113の裏側において、各信号給電用リード端子112をそれぞれグランド用リード端子414とグランド用リード端子114の間に挟み込んだ実施の形態4と同様の構成としている。

以上のように構成された実施の形態5の光半導体デバイスは、実施の形態1及 び実施の形態4の効果を併せ持っており、信号の反射を効果的に抑えることがで きる。

[0028]

このように、本発明に係る実施の形態 $1\sim5$ に記載の光半導体デバイスはそれぞれ、伝送線路 $A\sim D$ の間における信号の反射を低減できる光半導体素子用パッケージを用いて構成されているので、高周波特性の良好な光半導体素子を提供できる。

尚、以上の実施の形態では、光半導体素子としてレーザ素子を用いた例について説明したが、本発明はこれに限られるものではなく、光半導体素子として受光素子を用いても実施の形態と同様の効果が得られる。

[0029]

【発明の効果】

以上、詳細に説明したことから明らかなように、本発明によれば、10Gbpsの高速伝伝送用に用いることができる高周波特性の良好なステム型の光半導体素子用パッケージを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本発明に係る実施の形態1の光半導体デバイスの斜視図(a)と 平面図(b)である。
 - 【図 2 】 (a)は、取り囲み角度 θ に対する伝送線路Dのインピーダンス

(特性インピーダンス)を、3次元電磁界シミュレータによって解析した結果を示すグラフであり、(b)は、伝送線路Cと伝送線路Dの境界における反射量S 11 (dB) の角度 θ 依存性の解析(シミュレーション)結果を示すグラフである。

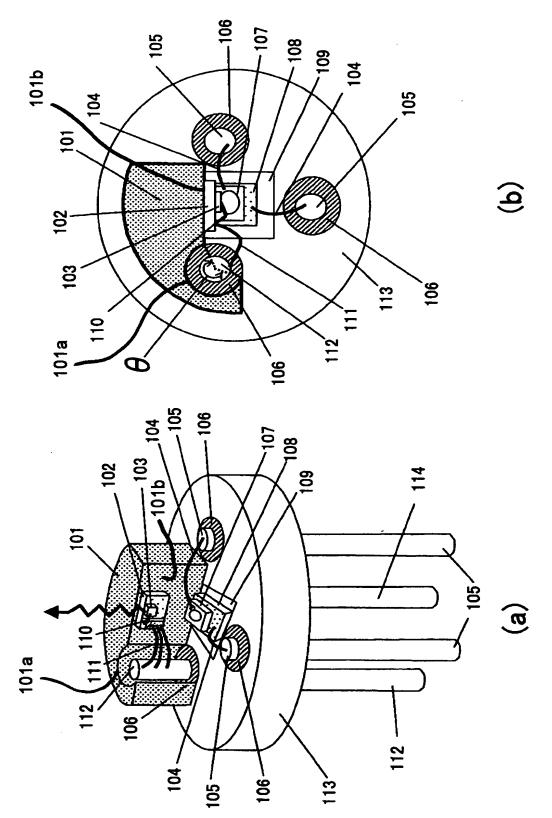
- 【図3】 本発明に係る実施の形態2の光半導体デバイスの斜視図(a)と平面図(b)である。
- 【図4】 本発明に係る実施の形態3の光半導体デバイスの斜視図(a)と 平面図(b)である。
- 【図5】 本発明に係る実施の形態4の光半導体デバイスの背面側において、給電基板との間の接続の様子を示す斜視図(a)と平面図(b)である。
- 【図6】 接続部分Bにおける電気反射量S11 (dB)を、3次元電磁界シミュレーターで解析した結果を示すグラフである。
- 【図7】 実施の形態4の変形例に係る光半導体デバイスの背面側において、給電基板との間の接続の様子を示す斜視図(a)と平面図(b)である。
- 【図8】 本発明に係る実施の形態5の光半導体デバイスの斜視図(a)と 平面図(b)である。
- 【図9】 従来例の光半導体デバイスの斜視図(a)と平面図(b)である。
- 【図10】 光半導体デバイスの背面側において、給電基板との間の接続の様子を示す斜視図(a)と平面図(b)である。

【符号の説明】

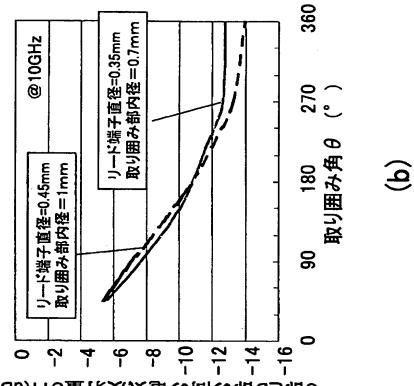
101 マウント、101a 円周面、101b マウント面、102 サブマウント、103 レーザ素子、106 ガラス材料、112 信号供給用リード端子、113 ステムボディー、114,414 接地(グランド)用リード端子、115 信号ライン、116 グランドライン、117 給電基板、201 対向接地電極部、301 誘電体板、A,C,D 伝送線路、B 接続部分。

【書類名】 図面

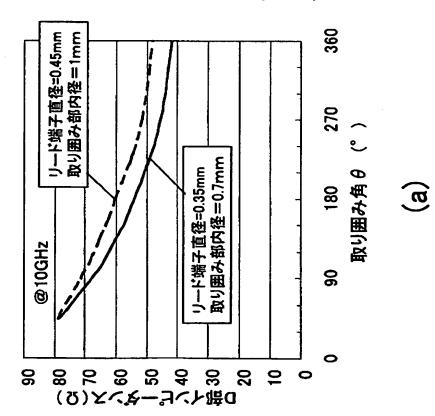
【図1】



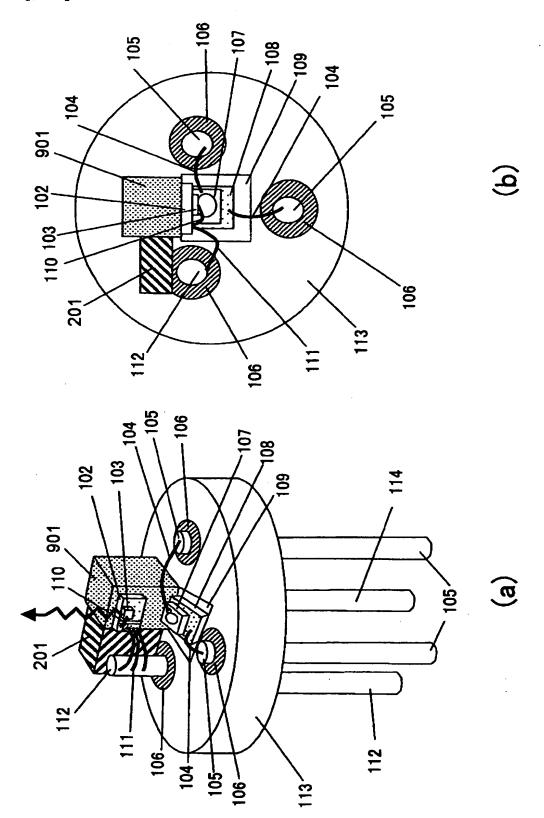




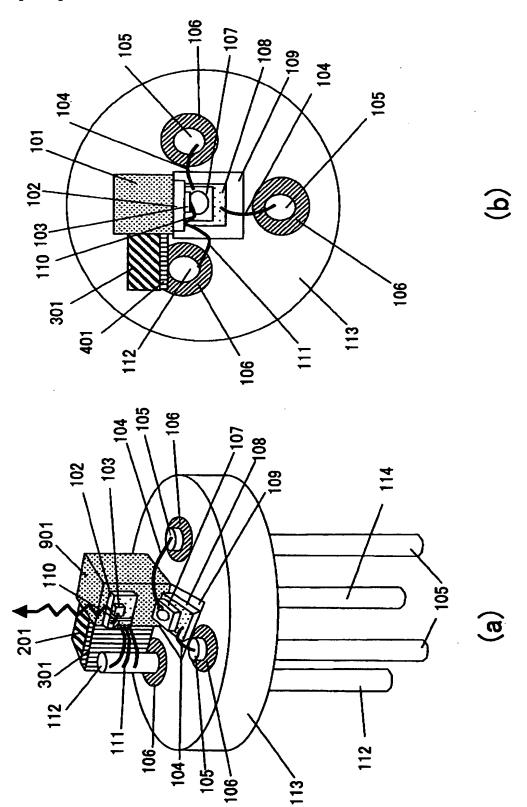
C部とD部の間の電気反射量S11(dB)



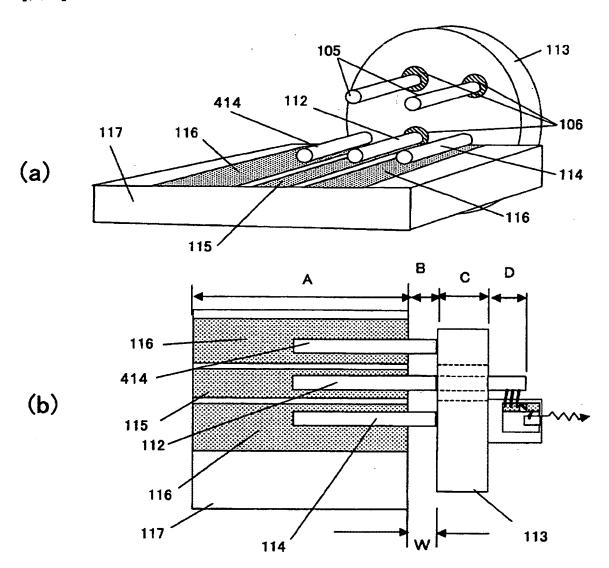
【図3】



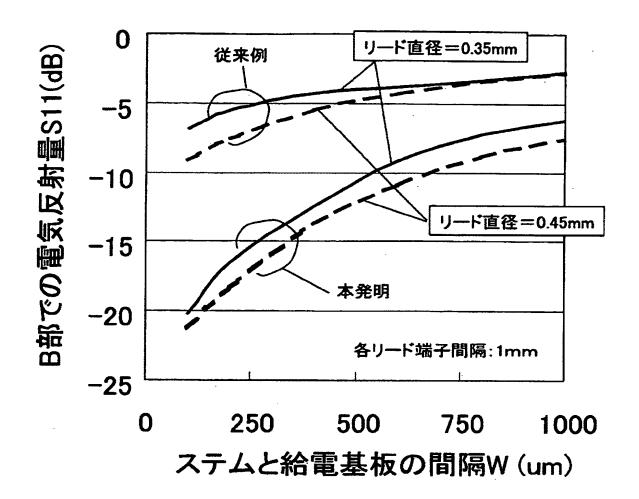
【図4】



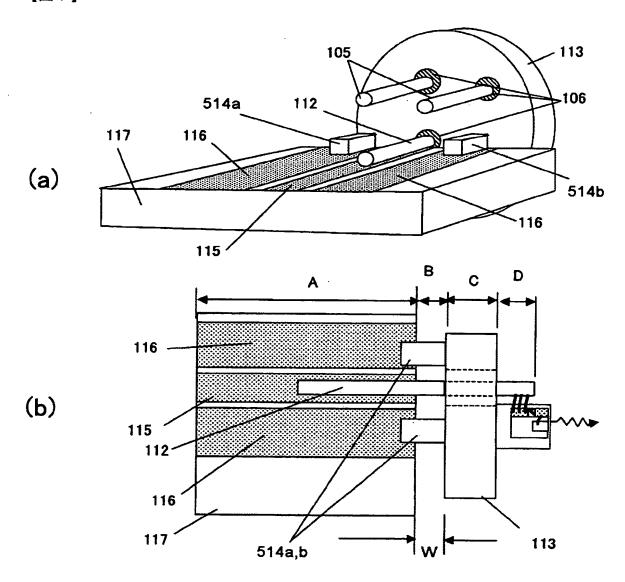
【図5】



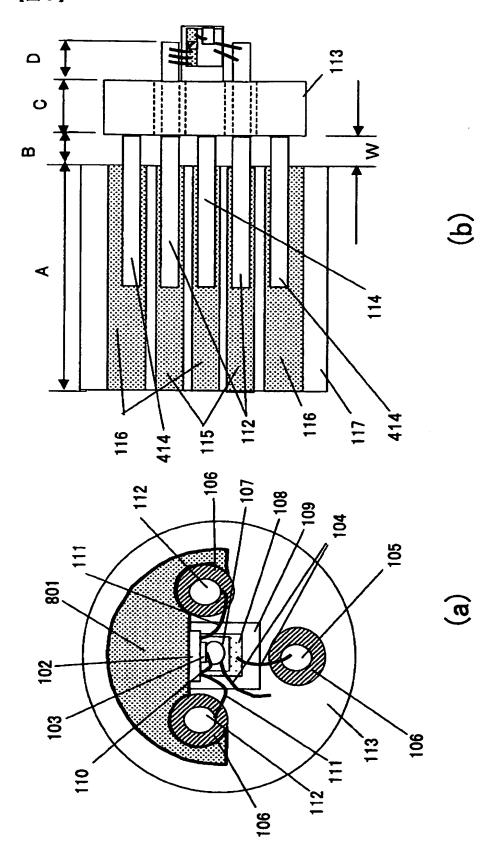
【図6】



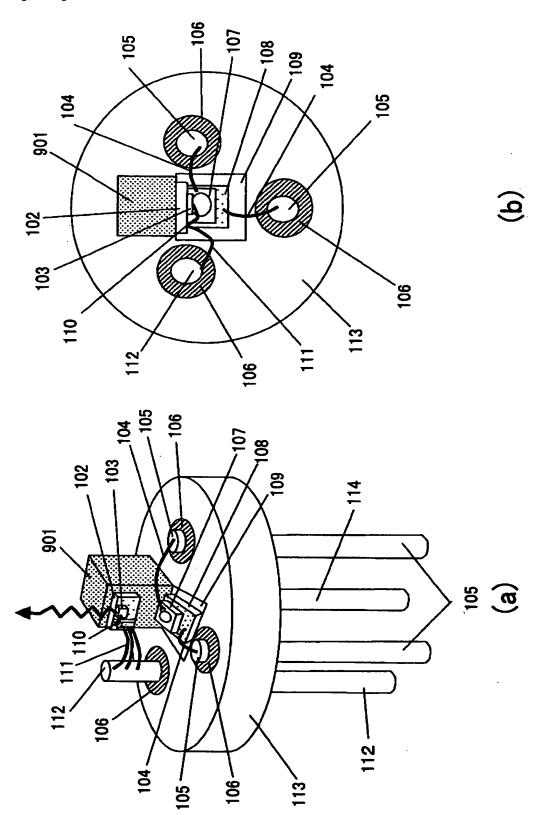
【図7】



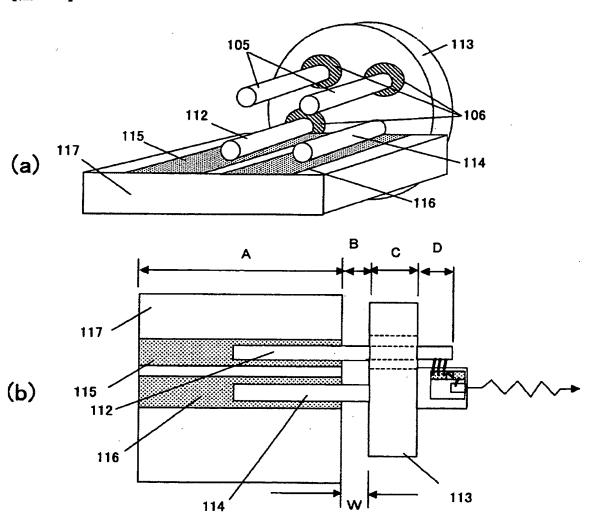
【図8】



【図9】



【図10】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 10Gbps以上の高速伝伝送用に用いることができる高周波特性の 良好なステム型のパッケージを提供する。

【解決手段】 上面と下面を有しその上面から下面に貫通する貫通孔が形成されたステムと貫通孔を絶縁体を介して絶縁されて貫通する信号供給用リード端子を備えた光半導体素子用パッケージにおいて、貫通孔と絶縁体と信号供給用リード端子とによって構成される伝送線路の特性インピーダンスと、上面から突出した信号供給用リード端子によって構成される伝送線路の特性インピーダンスとの差が小さくなるように、上面から突出した信号供給用リード端子に近接して接地導体を設けた。

【選択図】 図1

特願2003-088306

出願人履歴情報

識別番号

[000006013]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

氏 名

三菱電機株式会社